PLASMA DISPLAY PANEL AND METHOD OF MANUFACTURING THE PLASMA DISPLAY PANEL

Publication number: JP2002231129
Publication date: 2002-08-16

Inventor:

KADO HIROYUKI

Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international:

H01J9/26; H01J9/02; H01J11/02; H01J9/26; H01J9/02; H01J11/02; (IPC1-7): H01J9/02; H01J9/26; H01J11/02

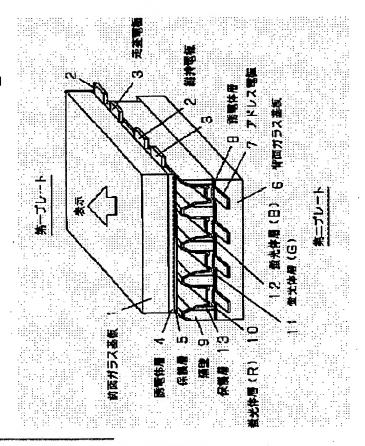
- european:

Application number: JP20010029084 20010206 Priority number(s): JP20010029084 20010206

Report a data error here

Abstract of JP2002231129

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a plasma display panel capable of being driven at a low voltage and a method of manufacturing the plasma display panel. SOLUTION: Protective layers 5 and 13 formed with one or more of calcium oxide, strontium oxide, and barium oxide are provided on the surfaces of a first plate and a second plate having at least a fluorescent material layer 10 provided thereon.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-231129

(P2002-231129A)

(43)公開日 平成14年8月16日(2002.8.16)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FI		ā	テーマコード(参考)	
H01J	9/02		H01J	9/02	F	5 C O 1 2	
	9/26			9/26	A	5 C O 2 7	
	11/02			11/02	В	5 C O 4 O	

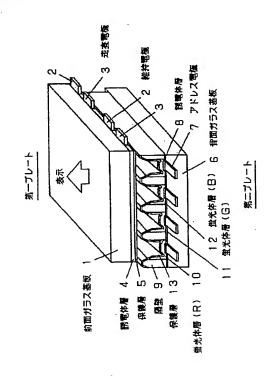
全 10 頁)		
000005821 松下電器産業株式会社		
松下電器		
位上面的		
GE02		
JA40		
•		

プラズマディスプレイパネルおよびその製造方法 (54) 【発明の名称】

(57)【要約】

【課題】 低電圧駆動が可能なプラズマディスプレイバ ネルおよびその製造方法を提供する。

【解決手段】 第一プレートおよび少なくとも蛍光体層 10が設けられた第二プレート表面に酸化カルシウム、 酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち1種類あるい は2種類以上からなる保護層5、13を設ける。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 第一プレートに保護層を形成する保護層形成工程と、前記第一プレート面と、少なくとも蛍光体層を形成した第二プレート面とを対向させて当該二枚のプレート間を封着する封着工程とを経るプラズマディスプレイパネルの製造方法であって、

1

前記保護層は、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化パリウムのうち少なくとも1種類以上を含み、少なくとも前記保護層形成工程後から前記封着工程までを乾燥雰囲気中で連続して行うことを特徴とするプラズマデ 10ィスプレイパネルの製造方法。

【請求項2】 保護層が酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化パリウムのうち少なくとも2種類以上の混合物からなることを特徴とする請求項1記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。

【請求項3】 保護層が酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち少なくとも2種類以上が積層された構成であることを特徴とする請求項1記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。

【請求項4】 保護層の最表面層が、酸化マグネシウム であることを特徴とする請求項3記載のプラズマディス プレイパネルの製造方法。

【請求項5】 保護層が酸化ストロンチウムと酸化バリウムの混合物からなることを特徴とする請求項1記載のプラズマディスプレイバネルの製造方法。

【請求項6】 少なくとも蛍光体層を形成した第二プレートを乾燥雰囲気中で加熱する加熱工程を有し、保護層形成工程後および前記加熱工程から前記封着工程までを乾燥雰囲気中で連続して行うことを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載のプラズマディスプレイバネルの製造方法。

【請求項7】 第一プレートに保護層を形成する保護層 形成工程と、少なくとも蛍光体層を形成した第二プレー トに保護層を形成する保護層形成工程と、前記第一プレート面と前記第二プレート面とを対向させて当該二枚の プレート間を封着する封着工程とを経るプラズマディス プレイパネルの製造方法であって、

前記第一プレートの保護層は、酸化マグネシウムからなり、前記第二プレートの保護層は、酸化カルシウム、酸 40 化ストロンチウム、酸化パリウムのうち少なくとも1種類以上を含み、少なくとも前記第二プレートへの保護層形成工程後から前記封着工程までを乾燥雰囲気中で連続して行うことを特徴とするプラズマディスプレイパネルの製造方法。

【請求項8】 第二プレートの保護層が酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち少なくとも2種類以上の混合物からなることを特徴とする請求項7記載のプラズマディスプレイバネルの製造方法。

【請求項9】 第二プレートの保護層が酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち少なくとも2種類以上が積層された構成であることを特徴とする請求項8記載のプラズマディスプレイバネルの製造方法。

【請求項10】 第二プレートの保護層の最表面層が、酸化マグネシウムであることを特徴とする請求項9記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。

【請求項11】 第二プレートの保護層が酸化ストロン チウムと酸化バリウムの混合物からなることを特徴とす る請求項7記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。

【請求項12】 少なくとも前記第一および第二プレートへの保護層形成工程後から前記封着工程までを乾燥雰囲気中で連続して行うことを特徴とする請求項7から11のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。

【請求項13】 第一プレートに保護層を形成する保護層形成工程と、少なくとも蛍光体層を形成した第二プレートに保護層を形成する保護層形成工程と、前記第一プレート面と前記第二プレート面とを対向させて当該二枚のプレート間を封着する封着工程とを経るプラズマディスプレイパネルの製造方法であって、

前記第一プレートおよび第一プレートの保護層は、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち少なくとも1種類以上を含み、少なくとも前記第一プレートおよび第二プレートへの保護層形成工程後から前記封着工程までを乾燥雰囲気中で連続して行うことを特徴とするプラズマディスプレイバネルの製造方法。

30 【請求項14】 少なくとも第一プレートあるいは第二 プレートのいずれかの保護層が酸化マグネシウム、酸化 カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち 少なくとも2種類以上の混合物からなることを特徴とす る請求項13記載のプラズマディスプレイパネルの製造 方法。

【請求項15】 少なくとも第一プレートあるいは第二プレートのいずれかの保護層が酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち少なくとも2種類以上が積層された構成であることを特徴とする請求項13記載のプラズマディスプレイバネルの製造方法。

【請求項16】 少なくとも第一プレートあるいは第二プレートのいずれかの保護層の最表面層が、酸化マグネシウムであることを特徴とする請求項15記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。

【請求項17】 少なくとも第一プレートあるいは第二プレートのいずれかの保護層が酸化ストロンチウムと酸化バリウムの混合物からなることを特徴とする請求項13記載のプラズマディスプレイバネルの製造方法。

50 【請求項18】 第二プレートの保護層が第一プレート

の保護層よりも薄いことを特徴とする請求項7から17 のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルの製造 方法。

【請求項19】 第二プレートの保護層が100nm以下の厚さであることを特徴とする請求項7から18のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法

【請求項20】 少なくとも蛍光体層を形成した第二プレートを乾燥雰囲気中で加熱する加熱工程を有し、前記加熱工程から前記第二プレートへの保護層形成工程まで 10を乾燥雰囲気中で連続して行うことを特徴とする請求項7から19のいずれかに記載のプラズマディスプレイバネルの製造方法。

【請求項21】 封着工程から排気工程までを乾燥雰囲気中で連続して行うことを特徴とする請求項1から20のいずれかに記載のプラズマディスプレイバネルの製造方法。

【請求項22】 前記第二プレートの加熱工程または封着工程の乾燥雰囲気が、酸素ガスもしくは酸素を含むガスであることを特徴とする請求項1から21のいずれか 20 に記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。

[請求項23] 前記乾燥雰囲気中で連続して行う工程間の雰囲気を、大気圧よりも陽圧の乾燥ガス雰囲気に保持することを特徴とする請求項1から22のいずれかに記載のプラズマディスプレイバネルの製造方法。

【請求項24】 乾燥雰囲気が露点-20℃以下のガス 雰囲気であることを特徴とする請求項1から23のいず れかに記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。

【請求項25】 一対の平行に配された少なくとも酸化マグネシウムからなる保護層が形成された第一プレートと、少なくとも蛍光体層が形成された第二プレートの間に、ガス媒体が封入された放電空間が形成されたプラズマディスプレイバネルであって、

前記第二プレートの最表面が保護層で覆われ、前記保護 層は、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリ ウムのうち少なくとも1種類以上を含むことを特徴とす るプラズマディスプレイパネル。

[請求項26] 第二プレートの保護層が酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち少なくとも2種類以上の混合物からなることを特徴とする請求項25記載のプラズマディスプレイバネル

【請求項27】 第二プレートの保護層が酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち少なくとも2種類以上が積層された構成であることを特徴とする請求項25記載のプラズマディスプレイパネル。

【請求項28】 第二プレートの保護層の最表面層が、 酸化マグネシウムであることを特徴とする請求項27記 載のプラズマディスプレイパネル。 【請求項29】 第二プレートの保護層が酸化ストロンチウムと酸化バリウムの混合物からなることを特徴とする請求項25記載のプラズマディスプレイパネル。

[請求項30] 一対の平行に配された第一プレートと、少なくとも蛍光体層が形成された第二プレートの間に、ガス媒体が封入された放電空間が形成されたプラズマディスプレイパネルであって、

前記第一プレートおよび第二プレートの最表面が保護層で覆われ、前記保護層は、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化パリウムのうち少なくとも1種類以上を含むことを特徴とするプラズマディスプレイパネル。

【請求項31】 少なくとも第一プレートあるいは第二プレートのいずれかの保護層が酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち少なくとも2種類以上の混合物からなることを特徴とする請求項30記載のプラズマディスプレイパネル。

【請求項32】 少なくとも第一プレートあるいは第二プレートのいずれかの保護層が酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち少なくとも2種類以上が積層された構成であることを特徴とする請求項30記載のプラズマディスプレイバネル

【請求項33】 少なくとも第一プレートあるいは第二プレートのいずれかの保護層の最表面層が、酸化マグネシウムであることを特徴とする請求項32記載のプラズマディスプレイパネル。

【請求項34】 少なくとも第一プレートあるいは第二 プレートのいずれかの保護層が酸化ストロンチウムと酸 化パリウムの混合物からなることを特徴とする請求項3 0記載のプラズマディスプレイパネル。

[請求項35] 一対の平行に配された少なくとも保護 層が形成された第一プレートと、少なくとも蛍光体層が 形成された第二プレートの間に、ガス媒体が封入された 放電空間が形成されたプラズマディスプレイパネルであ って、

前記保護層は、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち少なくとも2種類以上の混合物からなることを特徴とするプラズマディスプレイパネル。

【請求項36】 一対の平行に配された少なくとも保護 層が形成された第一プレートと、少なくとも蛍光体層が 形成された第二プレートの間に、ガス媒体が封入された 放電空間が形成されたプラズマディスプレイバネルであ

前記保護層は、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化パリウムのうち少なくとも2種類以上が積層された構成であることを特徴とするプラズマディスプレイパネル。

【請求項37】 請求項1から24のいずれかの製造方50 法により製造されたことを特徴とするプラズマディスプ

レイパネル。

【請求項38】 第二プレートの保護層が第一プレートの保護層よりも薄いことを特徴とする請求項25から34または37のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネル。

5

【請求項39】 第二プレートの保護層が100nm以下の厚さであることを特徴とする請求項25から34または37または38のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネル。

【請求項40】 プラズマディスプレイパネルと前記プ 10 ラズマディスプレイパネルを駆動する駆動回路とを備えたプラズマディスプレイパネル表示装置であって、前記プラズマディスプレイパネルが請求項25から39

前記プラズマディスプレイパネルが請求項25から39 のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルである ことを特徴とするプラズマディスプレイパネル表示装 置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プラズマディスプレイパネルおよびその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、高品質な表示や大画面化などディスプレイのさらなる高性能化が要求されるようになり、種々のディスプレイの開発がなされている。注目される代表的なディスプレイとしては、CRTディスプレイ、液晶ディスプレイ(LCD)、プラズマディスプレイバネル(PDP)などが挙げられる。

【0003】以下では、従来のプラズマディスプレイバネルについて図面を参照しながら説明する。図4は交流型(AC型)のプラズマディスプレイバネルの概略を示 30 す断面図である。

【0004】図4において、第一プレートは、前面ガラス基板41上に維持電極および走査電極42が形成されている。さらに、これらの電極42は、誘電体層43及び酸化マグネシウム(MgO)保護層44により覆われている。

【0005】また、第二プレートは、背面ガラス基板45上に、アドレス電極46および隔壁47、蛍光体層(50~52)が設けられており、49が放電ガスを封入する放電空間となっている。前記蛍光体層はカラー表40示のために、赤50、緑51、青52の3色の蛍光体層が順に配置されている。上記の各蛍光体層(50~52)は、放電によって発生する波長の短い真空紫外線(波長147nm)により励起発光する。

【0006】蛍光体層50~52を構成する蛍光体としては、一般的に以下の材料が用いられている。

「青色蛍光体」:BaMgAl₁₀O₁₇:Eu

「緑色蛍光体」:Zn,SiO,:MnまたはBaAl,, O,,:Mn

「赤色蛍光体」:Y, O,: E u または(Y, G d , - ,)B 50 バリウムの混合物からなることが好ましい。

 O_1 : Eu

この 2 枚のガラス基板間の放電空間にはNe-Xe 等の混合ガスを封入し、放電により発生する波長の短い真空紫外光(147nm)によって蛍光体層($50\sim52$)が励起され、R、G、Bの可視光を前面ガラス基板側から発することによりカラー表示を行っている。

【0007】PDPの動作電圧は、この保護層の2次電子放出係数に依存する。従って仕事関数が酸化マグネシウムよりも小さいアルカリ土類金属の酸化物を誘電体膜表面の保護層として用いることで、動作電圧を低電圧化することが提案されている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、PDPの動作電圧としての、維持電極と走査電極間に印加する維持電圧は、前記構成で低減できるが、これらの電極とアドレス電極に印加するアドレス電圧の低減に関しては、この構成だけでは不十分であった。

【0009】さらに、これらのアルカリ土類金属の酸化物は吸湿性が高く、保護膜形成後に雰囲気中の水分を吸 20 着し、水酸化物に変質し、結果的に不安定な放電特性となるという課題があった。

【0010】以上のように低電圧駆動が可能なPDPを 製造し、これを得るためには、いまだ多くの改良の余地 がみられる。

【0011】本発明は上記課題に鑑みてなされたものであって、その目的は、低電圧駆動可能な保護層を備える優れた発光効率のPDPおよびその製造方法を提供するととにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、本発明のブラズマディスプレイパネルの製造方法は、第一ブレートに保護層を形成する保護層形成工程と、前記第一プレート面と、少なくとも蛍光体層を形成した第二プレート面とを対向させて当該二枚のプレート間を封着する封着工程とを経るプラズマディスプレイパネルの製造方法であって、前記保護層は、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち少なくとも1種類以上を含み、少なくとも前記保護層形成工程後から前記封着工程までを乾燥雰囲気中で連続して行うことを特徴とする。

【0013】前記構成において、保護層が酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち少なくとも2種類以上の混合物からなることが好ましい。

【0014】また、保護層が酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち少なくとも2種類以上が積層された構成であることが好ましい。

【0015】また、保護層が酸化ストロンチウムと酸化 バリウムの混合物からなることが好ました。 [0016] さらに、少なくとも蛍光体層を形成した第二プレートを乾燥雰囲気中で加熱する加熱工程を有し、 保護層形成工程後および前記加熱工程から前記封着工程 までを乾燥雰囲気中で連続して行うことが好ましい。

【0017】また、本発明のプラズマディスプレイパネルの製造方法は、第一プレートに保護層を形成する保護層形成工程と、少なくとも蛍光体層を形成した第二プレートに保護層を形成する保護層形成工程と、前記第一プレート面と前記第二プレート面とを対向させて当該二枚のプレート間を封着工程とを経るプラズマディ 10スプレイパネルの製造方法であって、前記第一プレートの保護層は、酸化マグネシウムからなり、前記第二プレートの保護層は、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化パリウムのうち少なくとも1種類以上を含み、少なくとも前記第二プレートへの保護層形成工程後から前記封着工程までを乾燥雰囲気中で連続して行うことを特徴とする。

【0018】前記構成において、第二プレートの保護層が酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち少なくとも2種類以上の混合 20物からなることが好ましい。

【0019】また、第二プレートの保護層が酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち少なくとも2種類以上が積層された構成であることが好ましい。

【0020】また、第二プレートの保護層が酸化ストロンチウムと酸化バリウムの混合物からなることが好ましい。

【0021】さらに、少なくとも前記第一および第二プレートへの保護層形成工程後から前記封着工程までを乾 30 燥雰囲気中で連続して行うことが好ましい。

【0022】また、本発明のプラズマディスプレイパネルの製造方法は、第一プレートに保護層を形成する保護層形成工程と、少なくとも蛍光体層を形成した第二プレートに保護層を形成する保護層形成工程と、前記第一プレート面と前記第二プレート面とを対向させて当該二枚のプレート間を封着する封着工程とを経るプラズマディスプレイパネルの製造方法であって、前記第一プレートおよび第一プレートの保護層は、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち少なくとも1種類 40以上を含み、少なくとも前記第一プレートおよび第二プレートへの保護層形成工程後から前記封着工程までを乾燥雰囲気中で連続して行うことを特徴とする。

[0023] 前記構成において、少なくとも第一プレートあるいは第二プレートのいずれかの保護層が酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化パリウムのうち少なくとも2種類以上の混合物からなることが好ましい。

【0024】また、少なくとも第一プレートあるいは第 も蛍光体層が形成された第二プレートの間に、ガス媒体 ニプレートのいずれかの保護層が酸化マグネシウム、酸 50 が封入された放電空間が形成されたプラズマディスプレ

化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち少なくとも2種類以上が積層された構成であることが好ましい。

【0025】また、少なくとも第一プレートあるいは第 二プレートのいずれかの保護層が酸化ストロンチウムと 酸化パリウムの混合物からなることが好ましい。

【0026】また、これらの構成において、第二プレートの保護層が第一プレートの保護層よりも薄いことが好ましい。

LO 【0027】さらに、第二プレートの保護層が100nm以下の厚さであることが好ましい。

【0028】さらに、少なくとも蛍光体層を形成した第二プレートを乾燥雰囲気中で加熱する加熱工程を有し、前記加熱工程から前記第二プレートへの保護層形成工程までを乾燥雰囲気中で連続して行うことが好ましい。

【0029】さらに、封着工程から排気工程までを乾燥 雰囲気中で連続して行うことが好ましい。

[0030] さらに、前記第二プレートの加熱工程または封着工程の乾燥雰囲気が、酸素ガスもしくは酸素を含むガスであることが好ましい。

【0031】さらに、前記乾燥雰囲気中で連続して行う 工程間の雰囲気を、大気圧よりも陽圧の乾燥ガス雰囲気 に保持することが好ましい。

【0032】さらに、乾燥雰囲気が露点-20℃以下のガス雰囲気であることが好ましい。

【0033】また、上記課題を解決するために、本発明のプラズマディスプレイパネルは、一対の平行に配された少なくとも酸化マグネシウムからなる保護層が形成された第二プレートの間に、ガス媒体が封入された放電空間が形成されたブラズマディスプレイパネルであって、前記第二プレートの最表面が保護層で覆われ、前記保護層は、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化パリウムのうち少なくとも1種類以上を含むことを特徴とすエ

【0034】前記構成において、第二プレートの保護層が酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化パリウムのうち少なくとも2種類以上の混合物からなることが好ましい。

(0035) また、第二プレートの保護層が酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち少なくとも2種類以上が積層された構成であることが好ましい。

【0036】また、第二プレートの保護層が酸化ストロンチウムと酸化バリウムの混合物からなることが好ましい。

[0037] また、本発明のプラズマディスプレイパネルは、一対の平行に配された第一プレートと、少なくとも蛍光体層が形成された第二プレートの間に、ガス媒体が封入された故郷空間が形成されたプラズマディスプレ

イパネルであって、前記第一プレートおよび第二プレー トの最表面が保護層で覆われ、前記保護層は、酸化カル シウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち少な くとも1種類以上を含むことを特徴とする。

【0038】前記構成において、少なくとも第一プレー トあるいは第二プレートのいずれかの保護層が酸化マグ ネシウム、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化 バリウムのうち少なくとも2種類以上の混合物からなる ととが好ましい。

【0039】また、少なくとも第一プレートあるいは第 10 二プレートのいずれかの保護層が酸化マグネシウム、酸 化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのう ち少なくとも2種類以上が積層された構成であることが 好ましい。

【0040】さらに、少なくとも第一プレートあるいは 第二プレートのいずれかの保護層が酸化ストロンチウム と酸化バリウムの混合物からなることが好ましい。

【0041】さらに、本発明のプラズマディスプレイバ ネルは、一対の平行に配された少なくとも保護層が形成 された第一プレートと、少なくとも蛍光体層が形成され 20 た第二プレートの間に、ガス媒体が封入された放電空間 が形成されたプラズマディスプレイパネルであって、前 記保護層は、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化 ストロンチウム、酸化バリウムのうち少なくとも2種類 以上の混合物からなることを特徴とする。

[0042]また、本発明のプラズマディスプレイバネ ルは、一対の平行に配された少なくとも保護層が形成さ れた第一プレートと、少なくとも蛍光体層が形成された 第二プレートの間に、ガス媒体が封入された放電空間が 形成されたプラズマディスプレイパネルであって、前記 30 保護層は、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化ス トロンチウム、酸化パリウムのうち少なくとも2種類以 上が積層された構成であることを特徴とする。

【0043】さらに、本発明のプラズマディスプレイバ ネルは、前記いずれかの製造方法により製造されたこと を特徴とする。

【0044】さらに、これらの構成において、第二プレ ートの保護層が第一プレートの保護層よりも薄いことが。 好ましい。

【0045】さらに、第二プレートの保護層が100n 40 m以下の厚さであることが好ましい。

【0046】さらに、本発明のプラズマディスプレイ表 示装置は、前記プラズマディスプレイパネルと前記プラ ズマディスプレイパネルを駆動する駆動回路とを備えた プラズマディスプレイパネル表示装置であることを特徴 とする。

[0047]

【発明の実施の形態】 (PDPの構成) 図1は、本発明 の実施の形態に係る交流面放電型プラズマディスプレイ バネル (以下単に「PDP」という) の主要構成を示す 50 第二プレートの最表面が仕事関数の小さな酸化カルシウ

部分的な断面斜視図である。

【0048】図1に示すように、PDPの構成は互いに 主面を対向させて配設された第一プレートおよび第二プ レートに大別される。

[0049] 第一プレートの基板となる前面ガラス基板 1には、その一方の主面に帯状の電極が積層され、複数 対の表示電極2、3(維持電極2、走査電極3)が形成 されている。

【0050】表示電極2、3を配設した前面ガラス基板 1には、当該ガラスの主面全体にわたって誘電体層4と 酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムの うち1種類あるいは2種類以上からなる保護層5が順次 形成されている。

【0051】第二プレートの基板となる背面ガラス基板 6には、その一方の主面に複数のアドレス電極7が一定 間隔毎にストライプ状に並設され、このアドレス電極7 を内包するように背面ガラス基板6の全面にわたって誘 電体層8が形成されている。誘電体層8の上には、さら に隣接するアドレス電極7の間隙に合わせて隔壁9が配 設され、そして隣接する2つの隔壁9の側面とその間の 誘電体層8の面上には、赤色(R)、緑色(G)、青色 (B) のそれぞれに対応する蛍光体層 10~12 が形成 されている。

【0052】さらに、との蛍光体層10~12を内包す るように背面ガラス基板6の全面にわたって酸化カルシ ウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち1種類 あるいは2種類以上からなる保護層13が形成されてい

【0053】このような構成を有する第一プレートと第 ニプレートは、アドレス電極7と表示電極2, 3の互い の長手方向が直交するように対向させながら、両プレー トの外周縁部をガラスフリットで封着されている。この 両プレート間にはHe、Xe、Neなどの希ガス成分か らなる放電ガス(封入ガス)が所定の圧力(通常500 ~600Torr(66、5~79、8kPa)程度) で封入されている。

【0054】(PDPの動作) CのPDPを駆動する時 には不図示のパネル駆動部によって、アドレス(走査) 電極7と表示電極2.3にパルスを印加して書き込み放 電 (アドレス放電)を行った後、各対の表示電極2,3 にパルスを印加する。これによりアドレス放電がなされ た当該表示電極2.3の間隙で放電が開始される。そし て放電空間において維持放電がなされ、画面表示が行わ れる。

【0055】ととで、本実施の形態の主な特徴は、酸化 カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち 1種類あるいは2種類以上からなる保護層5および保護 層13と、この構成を有するPDPの製造方法にある。

【0056】PDPの動作時には、第一プレートおよび

ム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち1種類あるいは2種類以上からなる保護層で覆われているために、電子放出特性が良好となり、従来に比べてアドレス電圧、維持電圧ともに低電圧駆動が可能なPDPが得られる。

[0057] (PDPの製造方法) 本実施の形態のPD Pの製造工程図を図2に示す。

【0058】本実施の形態のPDPの製造方法は、誘電体まで形成された前面ガラス基板に酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち1種類あるいは 102種類以上からなる保護層を形成する前面基板保護層形成工程、蛍光体層および封着用フリット(フリット焼成済み)まで形成された背面ガラス基板に酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち1種類あるいは2種類以上からなる保護層を形成する背面基板保護層形成工程、これらの基板を位置合わせするアライメント工程、その後に封着する封着工程、封着後のパネル内を排気し放電ガスを封入する排気工程からなり、これらの製造工程(搬送を含む)をドライガス供給装置を用い、乾燥雰囲気中で連続して行うものとした。 20

【0059】酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化パリウムのうち1種類あるいは2種類以上からなる保護層は蒸着法により形成したが、蒸着法の代わりに公知のスパッタ法やCVD法によっても保護層を形成することもできる。

[0060] なお、保護層形成工程以外は、ある程度の密閉性を持たせた室内に、ドライガスを導入し、内部を大気圧よりも陽圧のドライガス雰囲気に保持することで、比較的簡易な装置でドライガス雰囲気を実現することができた。

【0061】酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化パリウムのうち1種類あるいは2種類以上からなる保護層には吸水性があり、雰囲気中の水分が多いと水酸化物などに変質することがある。これは保護層としての機能を低下させる原因(具体的には、放電遅れの悪化や放電電圧の上昇による消費電力の増加などの原因)となる。また保護層中に取り込まれた水分は、封着工程ののちに蛍光体層へ移動し、これを変性させて表示性能の低下を招くことがある。

【0062】そこで、上記のように乾燥雰囲気で各工程 40 を行い、保護層に水分が含まれるのを抑制するものとした。これによって、水分の吸収を回避して純度よく形成された保護層により、PDPの動作時には蛍光体層の変性を防止しつつ、従来に比べてアドレス電圧、維持電圧ともに低電圧駆動が可能で、いっそう優れた表示性能が発揮されることとなる。

【0063】なお、上記実施の形態では、保護層の形成 方法としてスパッタリング、蒸着、あるいはCVDの例 を示したが、本発明はこれに限定するものではなく、印 刷法、ダイコート法、ゾルゲル法、CMD法などを用い 50

てもよい。ただし、これらの方法でも前述したドライガ ス雰囲気を用いる必要があることは言うまでもない。

12

【0064】また、第二プレートに厚い保護層を形成した場合、蛍光体を励起するための真空紫外線が十分に蛍光体まで透過することが困難になる。従って、第二プレートに形成された保護層は、第一プレートに形成された保護層よりも薄くすることが好ましく、また透過率をあげるために100nm以下にすることが好ましい。

【0065】さらに、蛍光体層を形成した第二プレートに保護層を形成する場合、あらかじめそれまでに付着した水分を除去するために、保護層形成工程の前に、第二プレートをドライガス雰囲気中で加熱する加熱工程を経ることで、さらに良好な保護層が形成された。ただし、この工程から保護層形成工程までの間をドライガス雰囲気中で連続して行う必要があることは言うまでもない。【0066】また、本実施の形態では封着工程後、排気工程を経たが、封着と排気を連続して行うことも可能である。

【0067】また、乾燥雰囲気を実現するためのドライ20 ガスとしては、空気、酸素、窒素等を用いることが可能であるが、露点-20℃以下のガスが望ましく、-40℃以下がさらに望ましい。

【0068】さらに、第二プレートの加熱工程または封着工程で用いるドライガスとしては、酸素ガスもしくは酸素を含むガスであることが望ましい。これは、PDP用蛍光体として酸化物蛍光体が多く、無酸素雰囲気で加熱すると酸素欠損等を生じ劣化する可能性があるためである。

【0069】(実施の形態の変形例1)本実施の形態では、第一プレートおよび第二プレートの両プレートに酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち1種類あるいは2種類以上からなる保護層を形成したが、第二プレート最表面は従来通り蛍光体層とし、第一プレート最表面のみに酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち1種類あるいは2種類以上からなる保護層を設けても良い。

【0070】との場合でも、低減幅は小さいが、駆動電 圧低減効果が得られた。

【0071】 このPDPの製造方法においても、第一プレートの酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち1種類あるいは2種類以上からなる保護層を安定に保持するために、前記保護層形成工程後から封着工程までを乾燥雰囲気中で連続して行う必要があることは言うまでもない。

[0072] さらに、蛍光体層を形成した第二プレートを第一プレートと対向させ封着する前に、あらかじめそれまでに付着した水分を除去するために、第二プレートを乾燥雰囲気中で加熱する加熱工程を経ることで、さらに安定したプロセスが実現した。ただし、この加熱工程から封着工程までの間を乾燥雰囲気中で連続して行う必

要があることは言うまでもない。

【0073】(実施の形態の変形例2)本実施の形態で は、第一プレートおよび第二プレートの両プレートに酸 化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのう ち1種類あるいは2種類以上からなる保護層を形成した が、第一プレート最表面は従来通り酸化マグネシウムか らなる保護層とし、第二プレート最表面のみに酸化カル シウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのうち1種 類あるいは2種類以上からなる保護層を設けても良い。

【0074】酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸 10 化バリウムのうち1種類あるいは2種類以上からなる保 護層は、電子放出特性は酸化マグネシウムよりも高い が、放電中の陽イオンによるスパッタに対しては、酸化 マグネシウムよりも弱いという欠点を有し、これらの材 料を保護層として用いた場合、PDPの寿命面で不利な 状況となる。

【0075】したがって、実施の形態の変形例2のよう に、PDPの駆動中に陽イオンによる衝撃が頻繁に起こ ることによる、第一プレート側は、従来通り酸化マグネ ・シウムを用いた保護層を設け、陽イオンによる衝撃が小 20 さい第二プレート側にのみ、酸化カルシウム、酸化スト ロンチウム、酸化パリウムのうち1種類あるいは2種類 以上からなる保護層を設けた構成とすることで、寿命の 問題もなく、かつ低電圧駆動が可能なPDPを実現する ことができた。

【0076】このPDPの製造方法においても、第二プ レートの酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バ リウムのうち1種類あるいは2種類以上からなる保護層 を安定に保持するために、前記保護層形成工程後から封 着工程までを乾燥雰囲気中で連続して行う必要があると 30 とは言うまでもない。

【0077】また、第一プレートの酸化マグネシウムか らなる保護層の形成工程後も、第二プレート保護層形成 後と同様に、乾燥雰囲気中で保つことで、さらに安定し たプロセスを実現できた。

【0078】さらに、蛍光体層を形成した第二プレート に保護層を形成する場合、あらかじめそれまでに付着し た水分を除去するために、保護層形成工程の前に、第二 プレートを乾燥雰囲気中で加熱する加熱工程を経ること で、さらに良好な保護層が形成された。ただし、この工 程から保護層形成工程までの間をドライガス雰囲気中で 連続して行う必要があることは言うまでもない。

【0079】以上の実施の形態において、保護層を酸化 カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウムのいず れか単独で形成するよりも、これらのうち二種類以上の 混合物として形成したり、積層して形成する方が電圧低 下には効果があった。これらのメカニズムは明確ではな いが、二種類以上の混合物あるいは積層物にすることで

保護層の仕事関数が低下し、電子放出能力が向上したた めと考えられる。なかでも、酸化ストロンチウムと酸化 バリウムの混合物を用いた場合が、低電圧化には最も効 果があった。

【0080】さらに、保護層として、酸化マグネシウム を、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウ ムに混合させることで、低電圧化だけでなく放電中のイ オン衝撃に対する耐性も向上した。

【0081】また、酸化カルシウム、酸化ストロンチウ ム、酸化バリウムのうち1種類あるいは2種類以上から なる保護層表面に、酸化マグネシウムを薄く被覆すると とによっても、低電圧化だけでなく放電中のイオン衝撃 に対する耐性向上に有効であった。この場合、低電圧効 果を維持するために、被覆する酸化マグネシウムは、1 0 n m以下が好ましい。

【0082】なお、PDPの駆動時には、図3に示すよ うに、PDPに各ドライバ及びパネル駆動回路90を接 続して、点灯させようとするセルの走査電極91aとア ドレス電極92間に印加してアドレス放電を行った後 に、表示電極91a, 91b間にパルス電圧を印加して 維持放電を行う。そして、当該セルで放電に伴って紫外 線を発光し、蛍光体層で可視光に変換する。とのように

[0083]

【実施例】本発明の効果を検証するために、前記実施の 形態に基づいて幾つかの構成の保護層を形成したPDP を作製し、従来のPDPと比較した。

してセルが点灯することによって、画像が表示される。

【0084】パネルは42"サイズである。隔壁の高さ は0.1mm、隔壁の間隔は0.36mmに設定した。 また、蛍光体材料としては

「青色蛍光体」:BaMgAl₁₀O₁₇:Eu

「緑色蛍光体」:Zn₂SiO₄:Mn

「赤色蛍光体」: (Y、Gd) BO;: Eu

を用いた。

【0085】酸化カルシウム(CaO)、酸化ストロン チウム (SrO)、酸化バリウム (BaO) のうち1種 類あるいは2種類以上からなる保護層および酸化マグネ シウム (Mg〇) からなる保護層は、電子ビーム蒸着に より作製し、第一プレート側は厚さ500nm、第二プ レート側は厚さ50nmとした。

【0086】封入する放電ガスの組成は、5%キセノン (Xe) ガスを含むネオン(Ne) ガスを放電ガスとし て500Torr (66.5kPa) 封入した。

【0087】表1に本実施例のPDPを駆動可能とする ためのアドレス電圧および維持電圧の測定結果を示す。

[8800]

【表1】

パネル番号	第一プレート 保護膜材料	第二ブレート 保護膜材料	アドレス電圧	維持電圧 (V)
1	CaO	CaO	62	160
2	SrO	SrO	49	147
. 3	BaO	BaO	46	142
4	BaO+SrO	BaO+SrO	42	135
5 .	BaO+CaO	BaO+CaO	44	138
6	BaO+SrO+CaO	BaO+SrO+CaO	· 44	137 .
7	BaO	なし	66	145
. 8	MgO	BaO	47	165
. 9	MgO	なし	70	180

[0089]パネルNo.1から7は本実施の形態の構成のパネルである。また、パネルNo.8は従来の構成を用いた比較例である。

15

[0090] 本実施の形態の保護層構成にすることで、アドレス電圧および維持電圧の低減することが可能となった。

【0091】 これは、酸化カルシウム、酸化ストロンチ 20 ウム、酸化パリウムのうち 1 種類あるいは 2 種類以上からなる保護層を有する PDPを、ドライ雰囲気中で安定に作製することが可能になったために、保護層の電子放出確率が向上し、放電電圧が低下したものと考えられる。

【0092】特に、保護層として酸化ストロンチウムと酸化バリウムの混合物を用いたPDPは、駆動電圧低減効果が大きかった。これは、酸化ストロンチウムと酸化バリウムの混合物とすることで、酸化ストロンチウムあるいは酸化バリウム単体よりも、仕事関数が低減され、電子放出能力が向上したためと考えられる。

[0093]なお、以上の実施例においては、面放電型のPDPを例示したが、対向放電型のPDPなど、保護層が必要なPDPすべてに適用することができる。 [0094]

【発明の効果】以上のことから明らかなように、本発明によれば、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化パリウムのうち1種類あるいは2種類以上からなる電子

放出特性の優れた保護層を安定に形成することが可能となり、これらの保護層を備えたPDPにより、アドレス電圧、維持電圧ともに低電圧化を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施の形態におけるPDPの主要構成図

【図2】実施の形態におけるPDPの製造工程を示す図

【図3】本実施の形態のPDPに駆動回路を接続したP DP表示装置を示す図

【図4】従来の交流面放電型プラズマディスプレイバネルの概略断面図

【符号の説明】

- 1 前面ガラス基板
- 2 維持電極
- 3 走査電極
- 4 誘電体層
- 5 保護層
- 30 6 背面ガラス基板
 - 7 アドレス電極
 - 8 誘電体層
 - 9 隔壁
 - 10 蛍光体層(R)
 - 11 蛍光体層(G)
 - 12 蛍光体層(B)
 - 13 保護層

